

場所

AIRBIC 会議室8

(川崎市幸区新川崎7-7 新川崎・創造のもり JR新川崎駅から徒歩10分)

講師

山本 貴富喜 先生 (東京科学大学工学院 准教授)

実習内容

フォトレジストの性質、精密露光や現像のテクニックについて講習を行ないます。さらにNANOBICのマスクアライナを使って実習を行なっていただくことで、精密フォトリソグラフィを習得できます。

実習機器

手動両面マスクアライナ (SUSS MicroTec社製 SUSS MA6 BSA) *

*機器詳細仕様は「NANOBICオープンラボ」ホームページ https://open-labo.skr.jp/ の設備一覧をご覧下さい。

5 / 1 4 (水)

13:30-16:30
※講習1時間、実習2時間



申込フォーム



日本工学会 ECEプログラム認定 慶應、早稲田、科学大、東大からなる4大学ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアムでは、川崎市、KISTECと連携し、産学連携による新しい技術や産業の創出を図るため、新川崎・創造のもりのナノ・マイクロ産学官共同研究施設「NANOBIC」において、4大学の先端機器の利用開放を行っています。今後、更に効果的に機器をご活用いただくため、企業や大学の方を対象とした「フォトリソグラフィ 講習・実習会」を開催しますのでご参加ください。

定員: 先着5名程度 参加費: 13,000円

主催: 4大学ナノ・マイクロファブリケーションコンソーシアム,(地独)神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC),川崎市

申込:下記申込フォームよりお申込みください。 https://forms.gle/EEgXHzZCsmGzb6pD9